



## TOPCON电池碱抛光清洗设备

### TOPCON Cell Alkaline Polishing&Cleaning Equipment

#### 特点描述

- 大产能设备，单次可处理6篮；
- 分布式盘管结合V型匀流板组成快速平稳的布液系统；
- 自补偿动态平衡废气排风系统，提高废气排风高效性；
- 派单式手臂调度系统，实现生产工艺柔性化；
- 工业热水机采用纯石英红外加热方式，确保无金属离子析出；
- 高效过滤与初效过滤相结合，很好的保证了设备内的洁净度；
- 高速稳定的机械手系统，负载 $\geq 100\text{Kg}$ ；
- 高分辨率防腐酸度PH计调节DIO3酸度值。

#### Features

- High-capacity equipment, capable of processing 6 baskets at a time;
- Distributed coil & V type runner plate forms a high-efficiency liquid distribution system;
- Self-compensating dynamic balancing exhaust system;
- Arm dispatch system, Achieve flexible production;
- Uses infrared heating system to heat water ; no metal ion precipitation;
- Combining efficient filtration with preliminary filtration, ensure higher cleanliness inside the device;
- High speed and stable manipulator system, load  $\geq 100\text{Kg}$ ;
- High-resolution anticorrosive pH meter adjusts the DIO3 acidity value.

#### 技术性能

产能：16000片/小时（每篮116片整片，6篮/槽）；  
碎片率 $< 0.3\%$ 。（硅片厚度 $\geq 110\mu\text{m}$ ）；  
反射率 $> 40\%$ ，单片抛光均匀性 $< 1\%$ ，片间抛光均匀性 $< 1\%$ ；  
台阶宽度大于 $15\mu\text{m}$ ；  
设备Uptime： $\geq 95\%$ ；  
设备产品良率 $> 99.9\%$ 。

#### Performance

Capacity:  $\geq 16000$  pcs/h (116 whole pieces per basket, 6 baskets/slots);  
Breakage rate  $< 0.3\%$  (Wafer thickness  $\geq 110\mu\text{m}$ );  
Reflectivity  $> 40\%$ , texture uniformity  $< 1\%$ ,  
Texture uniformity between cell  $< 1\%$ ;  
Step width greater than  $15\mu\text{m}$ ;  
Uptime:  $\geq 95\%$ ;  
Product yield  $> 99.9\%$ .

#### 技术参数 Parameter

项目 Item	数值 Value
清洗流程 Cleaning process	PreCln→Polish→Post1(→Mirco TEX →Post1)→DHF→DRY